

Procedeu de obținere a materialului fotosensibil în bază de semiconductor calcogenic amorf $As_2(S_xSe_{1-x})_3$, care constă în aceea că se dizolvă separat As_2S_3 și As_2Se_3 în monoetanolamină sau etilendiamină la temperatura de 20...40°C, apoi amestecurile se răcesc până la temperatura camerei și se amestecă într-un raport determinat de valoarea x, după care amestecul se depune pe un suport și se usucă cu aer având temperatura de până la 40 °C, timp de 2 ore.